

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2013년 11월 7일 (07.11.2013)



(10) 국제공개번호
WO 2013/165113 A1

- (51) 국제특허분류:
A61K 8/89 (2006.01) A61Q 1/00 (2006.01)
A61K 8/72 (2006.01) A61Q 19/00 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2013/003412
- (22) 국제출원일: 2013년 4월 22일 (22.04.2013)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2012-0045406 2012년 4월 30일 (30.04.2012) KR
10-2013-0043591 2013년 4월 19일 (19.04.2013) KR
- (71) 출원인: 주식회사 아모레퍼시픽 (AMOREPACIFIC CORPORATION) [KR/KR]; 140-777 서울시 용산구 한강로 2가 181번지, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 조혜전 (CHO, Hye Jeon); 446-904 경기도 용인시 기흥구 보라동 314-1, Gyeonggi-do (KR). 김경남 (KIM, Kyung Nam); 446-904 경기도 용인시 기흥구 보라동 314-1, Gyeonggi-do (KR). 최경호 (CHOI, Kyung Ho); 446-904 경기도 용인시 기흥구 보라동 314-1, Gyeonggi-do (KR). 최영진 (CHOI, Yeong Jin); 446-904

경기도 용인시 기흥구 보라동 314-1, Gyeonggi-do (KR).

(74) 대리인: 윤동열 (YOON, Dong Yol); 153-803 서울시 금천구 가산디지털1로 226 에이스하이엔드타워 5차 3층 윤앤리 특허 법률 사무소, Seoul (KR).

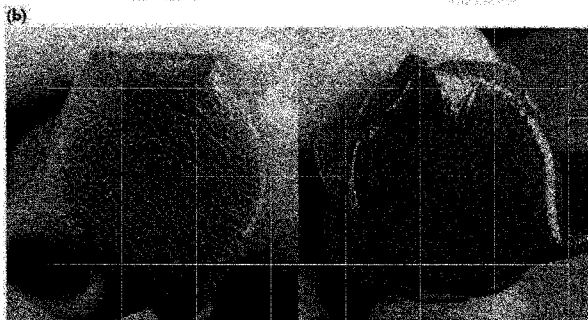
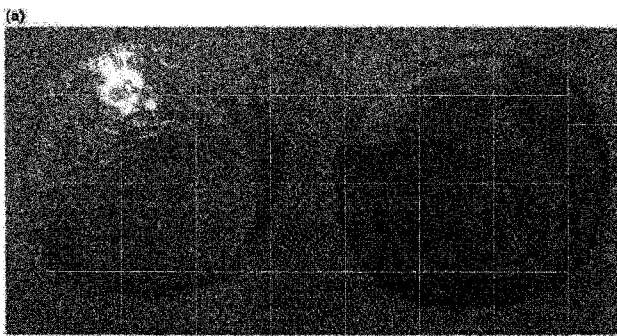
(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,

[다음 쪽 계속]

(54) Title: MAKE-UP COSMETIC COMPOSITION CONTAINING MQ SILICONE RESIN AND PROPYL SILSESQUOXANE RESIN

(54) 발명의 명칭: MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하는 메이크업 화장품 조성물



AA ... Comparative example 4
BB ... Embodiment 2

(57) Abstract: The present invention relates to a make-up cosmetic composition containing MQ silicone resin and propyl silsesquioxane resin, and, more specifically, relates to a make-up cosmetic composition which contains MQ silicone resin and propyl silsesquioxane resin, gives an outstanding moisturising impression and is free from any pulling phenomenon.

(57) 요약서: 본 발명은 MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하는 메이크업 화장품 조성물에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하여 보습감이 우수하고, 당김 현상이 없는 메이크업 화장품 조성물에 관한 것이다.

WO 2013/165113 A1

MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, **공개:**
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, — 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

명세서

발명의 명칭: MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하는 메이크업 화장품 조성물

기술분야

- [1] 본 발명은 MQ 실리콘 레진과 프로필실세스퀴옥산을 유효성분으로 함유하여 피부를 건조함 또는 피부 당김 현상 없이 촉촉하게 유지하는 메이크업 화장품 조성물에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 파운데이션 등의 메이크업化妆료를 피부에 도포하고 시간이 경과하면, 피부에서 배출되는 땀과 피지에 의하여 화장이 지워지는 현상이 관찰된다. 화장막을 장시간 지속시키기 위한 한 방법으로 MQ 실리콘 레진을 사용하여 피부에 대한 안료 또는 기타 활성제의 지속성을 개선할 수 있으나, MQ 실리콘 레진을 적용한 화장품은 건조하고 당김 현상이 발생하는 단점이 있다. 때문에, 현재 화장품 제형에 사용되는 MQ 실리콘 레진과 유사한 수준에서 보습감이 우수하고 당김 현상이 없는 실록산 수지가 요구된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [3] 본 발명에 있어서 피부 당김 현상이란 피부가 보습력이 부족하거나 수분 공급이 잘 이루어지지 않았을 때 쉽게 오는 현상으로 본 발명자들은 MQ 실리콘 레진과 프로필실세스퀴옥산의 피부 당김 방지 및 보습 효과가 우수함을 발견하고 본 발명을 완성하였다.
- [4] 따라서 본 발명은 MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하여 보습감이 우수하고, 당김 현상이 없는 메이크업 화장품 조성물을 제공함을 목적으로 한다.

과제 해결 수단

- [5] 본 발명은 MQ 실리콘 레진과 프로필실세스퀴옥산을 유효성분으로 함유하여 피부를 건조함 또는 피부 당김 현상 없이 촉촉하게 유지하는 메이크업 화장품 조성물에 관한 것이다.

발명의 효과

- [6] 본 발명에 따른 메이크업 화장품 조성물은 피부 위에 견고한 화장막을 형성하며 건조함이나 피부 당김 현상 없이 촉촉한 피부를 유지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [7] 도 1은 비교예 4 및 실시예 2를 인조피혁에 도포한 상태(a) 및 도포 후 15분간 건조한 뒤 잡아당긴 상태(b)의 사진이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [8] 본 발명은 MQ 실리콘 레진과 프로필실세스퀴옥산을 유효성분으로 함유하여 피부를 건조함 또는 피부 당김 현상 없이 촉촉하게 유지하는 메이크업 화장품 조성물에 관한 것이다.
- [9] 이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명한다.
- [10] 본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진은 $(R^1_3SiO_{1/2})_a$ 로 표시되는 M단위 및 $(SiO_{4/2})_b$ 로 표시되는 Q단위로부터 선택된다. 상기 R^1 은 독립적으로 탄소수 1 내지 8의 알킬 그룹 또는 아릴 그룹일 수 있다. 상기 알킬 그룹의 예는 메틸, 에틸, 프로필, 부틸, 펜틸 및 헥실 등이며, 상기 아릴 그룹의 예는 페닐, 나프틸, 벤질, 톨릴, 크실릴 및 크세닐 등이다. 상기 a 및 b는 0을 초과하는 정수를 나타내며, a/b의 비는 0.5 내지 1.5이다. 상기 MQ 실리콘 레진은 D 단위 및 T 단위 중 1종 이상을 더 함유할 수 있으며, 단 전체 MQ 실리콘 레진의 80mol% 이상, 또는 90mol% 이상은 M 및 Q 단위이다. 상기 MQ 실리콘 레진은 예를 들어 트리메틸실록시실리케이트일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [11] 본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 프로필실세스퀴옥산 수지는 $R^2SiO_{3/2}$ 로 표시되는 T단위를 전체 프로필세스퀴옥산 수지에 대하여 80mol% 이상 포함한다. 상기 R^2 는 독립적으로 탄소수 1 내지 8의 알킬 그룹 또는 아릴 그룹이며, 40mol% 이상은 프로필이다. 상기 프로필실세스퀴옥산 수지는 상기 M, D 및 Q 단위로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상을 더 함유할 수 있으며, 다만 이 경우에 있어서도 총 프로필실세스퀴옥산 수지의 80mol% 이상은 T 단위이다. 상기 프로필실세스퀴옥산 수지는 예를 들어 폴리프로필실세스퀴옥산일 수 있다.
- [12] 상기 M단위, D단위, T단위 및 Q단위는 실리콘 폴리머 단위로서 하기 화학식 1과 같이 표시될 수 있다.
- [13] 화학식 1
- $$\begin{array}{cccc} \text{M} & \text{D} & \text{T} & \text{Q} \\ \text{Si-O} & \text{O-Si-O} & \text{O-Si-O} & \text{O-Si-O} \\ & & | & | \\ & & \text{O} & \text{O} \end{array}$$
- [14] 본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진은 조성물 총 중량에 대하여 0.01~30 중량%로 함유할 수 있으며, 바람직하게는 0.01~10 중량%로 함유할 수 있다. 0.01 중량% 미만인 경우 피부 촉촉함에 크게 기여하지 못하고, 30 중량%를 초과하는 경우 당김 현상이 심하기 때문이다.
- [15] 본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 프로필실세스퀴옥산 수지는 조성물 총 중량에 대하여 0.01~30 중량%로 함유할 수 있으며, 바람직하게는 0.01~10 중량%로 함유할 수 있다. 0.01 중량% 미만인 경우 피부 촉촉함에 크게 기여하지 못하고, 30 중량%를 초과하는 경우 사용감이 무거워질 수 있기 때문이다.
- [16] 본 발명의 일 관점에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진과 프로필실세스퀴옥산

수지는 조성물 중 중량비로 1:150 내지 150:1 로 함유할 수 있으며, 바람직하게는 1:80 내지 80:1 로 함유할 수 있다. 상기 중량비를 벗어나는 경우에는 사용감을 저해할 수 있기 때문이다.

[17] 본 발명의 일 관점에 따른 조성물은 화장품학 또는 피부과학적으로 허용가능한 매질 또는 기체를 함유하여 제형화될 수 있다. 이는 국소적용에 적합한 모든 제형으로서, 바람직하게는 유중수형, 수중유형, 유분산형으로 이루어진 군에서 선택되는 유형을 포함할 수 있다. 또한 현탁액, 마이크로에멀전, 마이크로캡슐, 미세과립구 또는 이온형(리포솜) 및 비이온형의 소낭 분산제의 형태로, 또는 크림, 스킨, 로션, 파우더, 연고, 스프레이 또는 콘실 스틱의 형태로 제공될 수 있다. 또한 포말(foam)의 형태로 또는 압축된 추진제를 더 함유한 에어로졸 조성물의 형태로도 사용될 수 있다. 이들 조성물은 당해 분야의 통상적인 방법에 따라 제조될 수 있다.

[18] 본 발명의 일 관점에 따른 메이크업 화장료 조성물은 본 발명의 목적을 저해하지 않는 범위 내에서 당업계에서 화장료에 사용되는 지방 물질, 유기용매, 용해제, 농축제, 겔화제, 연화제, 향산화제, 현탁화제, 안정화제, 발포제, 방향제, 계면활성제, 물, 이온형 또는 비이온형 유화제, 충전제, 금속이온봉쇄제, 킬레이트화제, 보존제, 비타민, 차단제, 습윤화제, 필수 오일, 염료, 안료, 친수성 또는 친유성 활성제, 지질 소낭 또는 화장품에 통상적으로 사용되는 임의의 다른 성분과 같은 화장품학 또는 피부과학 분야에서 통상적으로 사용되는 보조제를 함유할 수 있다. 상기 보조제는 화장품학 또는 피부과학 분야에서 일반적으로 사용되는 양으로 도입된다. 또한, 본 발명의 조성물은 피부 개선 효과를 증가시키기 위하여 피부 흡수 촉진 물질을 함유할 수 있다.

발명의 실시를 위한 형태

[19] 이하, 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하고자 한다. 이들 실시예는 오로지 본 발명을 예시하기 위한 것으로, 본 발명의 범위가 이들 실시예에 의해 제한되는 것으로 해석되지 않는 것은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다

[20] [비교예 1~3 및 실시예 1]

[21] 하기 표 1의 조성에 따라 비교예 1~3 및 실시예 1을 제조하였다.

[22] 표 1

[Table 1]

성분(중량%)		비교예1	비교예2	비교예3	실시예1
유상	에틸헥실메톡시신나메이트	5.00	5.00	5.00	5.00
	사이클로펜타실록산	25.00	15.00	15.00	15.00
	메틸트리메치콘	5.00	5.00	5.00	5.00
	페닐트리메치콘	4.00	4.00	4.00	4.00
	트리메틸실록시실리케이트	-	10.00	-	5.00
	폴리프로필실세스퀴옥산	-	-	10.00	5.00
	피이지-10디메치콘	3.50	3.50	3.50	3.50
	세틸피이지/피피지-10/1디메치콘	1.00	1.00	1.00	1.00
분체	디스테아디모늄헥토라이트	1.50	1.50	1.50	1.50
	알킬실란 표면처리 산화티탄	8.00	8.00	8.00	8.00
	알킬실란 표면처리 황색산화철	0.60	0.60	0.60	0.60
	알킬실란 표면처리 적색산화철	0.20	0.20	0.20	0.20
	알킬실란 표면처리 흑색산화철	0.15	0.15	0.15	0.15
수상	폴리메틸메타크릴레이트	1.05	1.05	1.05	1.05
	징제수	38.70	38.70	38.70	38.70
	부틸렌글라이콜	5.00	5.00	5.00	5.00
	소듐클로라이드	1.00	1.00	1.00	1.00

[23] <제조방법>

[24] 1) 상기 유상성분 및 분체를 혼합하여 분산시켰다.

[25] 2) 수상성분을 모두 혼합하였다.

[26] 3) 상기 1)의 혼합물에 상기 2)의 혼합물을 서서히 첨가한 후 혼합하여 유화시켰다.

[27] 4) 상기 3)의 혼합물을 완전 탈기하여 유중수형 메이크업 화장료 조성물을 제조하였다.

[28]

[29] [시험예 1] 메이크업 화장료 조성물에 대한 관능평가

[30] 상기 비교예 1~3 및 실시예 1에 따른 조성물 각각을 25~39세의 여성 20명에게 얼굴에 도포하도록 한 뒤, 12시간 경과 후 설문에 의해 촉촉함, 피부 당김 현상이 없음의 2가지 평가항목에 대하여 평가하였으며, 각 평가기준은 각 항목에 대하여 5점 척도로 효과가 좋을수록 높은 점수를 부여하도록 하였다. 상기 점수의 평균값을 결과로 하여 하기 표 2에 나타내었다.

[31] 표 2

[Table 2]

평가 항목	비교예1	비교예 2	비교예 3	실시예 1
건조함 없이 촉촉하다	1.4	1.7	1.9	4.3
피부 당김 현상이 없다	1.3	1.5	1.8	4.2

[32] 상기 표 2의 결과에서, MQ 실리콘 레진 만을 함유하는 비교예 2의 경우 건조함이나 당김 현상에서 만족도가 낮게 나타났으며, 폴리프로필실세스퀴옥산 수지 만을 함유하는 비교예 3의 경우에도 건조함이나 당김 현상에서 만족도가

낮게 나타났다. 이에 비해 MQ 실리콘 레진과 폴리프로필실세스퀴옥산 수지 모두를 함유하는 실시예 1의 경우 상기 평가항목 모두에 있어서 높은 만족도를 나타내는 것을 알 수 있다. 따라서 본 발명에 따른 조성물은 MQ 실리콘 레진과 폴리프로필실세스퀴옥산 수지를 동시에 함유함으로써 보습감이 우수하며, 당김 현상을 감소시킬 수 있는 효과를 나타내는 것을 알 수 있다.

[33]

[34] [시험예 2] 건조함과 당김 현상 감소 평가

[35] 본 발명에 따른 MQ 실리콘 레진과 폴리프로필실세스퀴옥산 수지를 동시에 사용하였을 때 건조함과 당김 현상이 감소되는지 간이 실험으로 확인해보았다. 하기 표 3의 조성으로 실리콘 레진 용액에 분체 성분을 분산하고, 이 용액을 인조피혁에 얇게 도포한 후 15분간 건조시켰다. 상기 건조된 인조피혁을 상하좌우로 각각 30회씩 잡아당겨 물리적 자극을 가하고 용액이 도포된 인조피혁 표면을 관찰하였다. 상기 인조피혁 표면의 사진을 도 1에 나타내었다.

[36] 표 3

[Table 3]

성분(중량%)	비교예 4	실시예 2
트리메틸실록시실리케이트	95	47.5
폴리프로필실세스퀴옥산	-	47.5
알킬실란 표면처리 산화티탄	4.00	4.00
알킬실란 표면처리 황색산화철	0.30	0.30
알킬실란 표면처리 적색산화철	0.10	0.10
알킬실란 표면처리 흑색산화철	0.07	0.07
폴리메틸메타크릴레이트	0.53	0.53

[37] 도 1의 결과에서 확인할 수 있는 바와 같이, 인조피혁에 자극을 가한 후에 표면을 관찰하였을 때, 트리메틸실록시실리케이트만을 사용한 비교예 4의 경우 외부표면이 건조하고 찢겨져 있는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 유연성이 낮아 피부에서 당김 현상이 발생할 것을 예상할 수 있다. 그러나 트리메틸실록시실리케이트와 폴리프로필실세스퀴옥산을 1:1로 사용한 실시예 2의 경우, 표면이 뜯기거나 갈라짐 없이 촉촉하고 유연한 막을 형성하고 있음을 확인할 수 있었다.

산업상 이용가능성

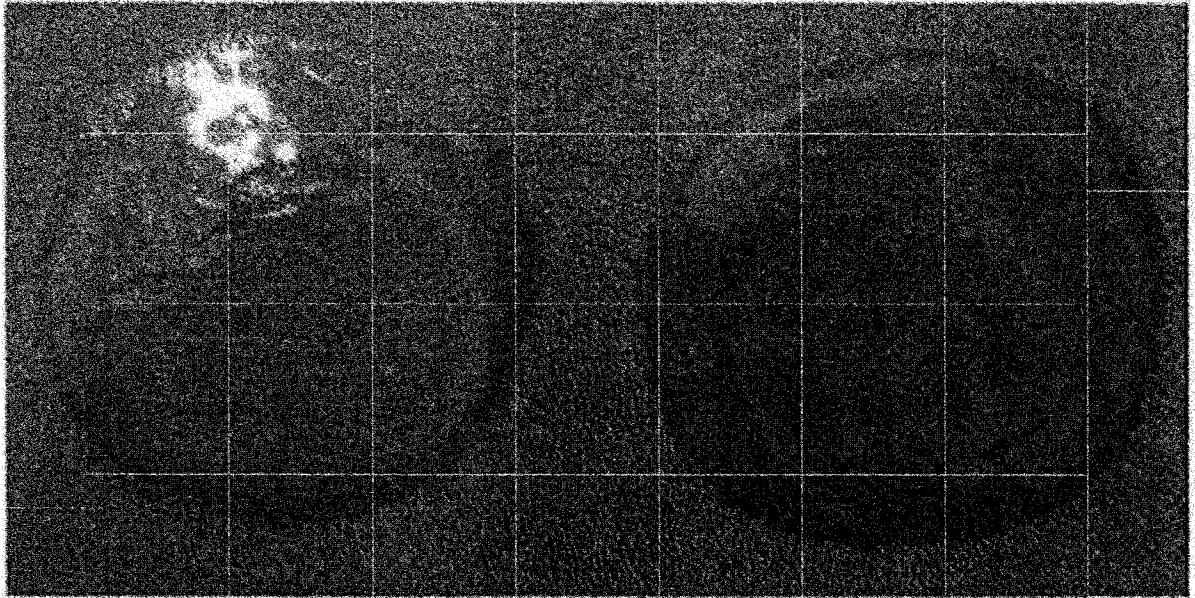
[38] 본 발명에 따른 메이크업 화장료 조성물은 MQ 실리콘 레진을 포함하면서도 보습감이 우수하며 당김 현상이 없는 실록산 수지 조성물을 제공하여 건조하고 당김 없이 촉촉한 화장 상태를 유지할 수 있는 화장품을 제공할 수 있다.

청구범위

- [청구항 1] MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하는 피부 보습용 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 2] MQ 실리콘 레진 및 프로필실세스퀴옥산 수지를 함유하는 피부 당김 감소용 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 3] 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진은 $(R^1_3SiO_{1/2})_a$ 로 표시되는 M 단위 및 $(SiO_{4/2})_b$ 로 표시되는 Q 단위로부터 선택된 실록시 단위를 전체 MQ 실리콘 레진의 80mol% 이상 포함하며, 상기 R^1 은 독립적으로 탄소수 1 내지 8의 알킬 그룹 또는 아릴 그룹이며, 상기 a 및 b는 0을 초과하는 정수를 나타내는 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 4] 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 프로필실세스퀴옥산 수지는 $R^2 SiO_{3/2}$ 로 표시되는 T 단위를 전체 프로필세스퀴옥산 수지의 80mol% 이상 포함하며, 상기 R^2 는 독립적으로 탄소수 1 내지 8의 알킬 그룹 또는 아릴 그룹이며, 상기 R^2 의 40mol% 이상은 프로필인 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 5] 제3항에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진의 80mol% 이상이 M 및 Q 단위인 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 6] 제4항에 있어서, 상기 프로필실세스퀴옥산 수지는 M, D 및 Q 단위로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상을 더 함유하는 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 7] 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진을 조성물 총 중량에 대하여 0.01 중량% 내지 30 중량%로 함유하는 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 8] 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 프로필실세스퀴옥산 수지를 조성물 총 중량에 대하여 0.01 중량% 내지 30 중량%로 함유하는 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 9] 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 MQ 실리콘 레진과 프로필실세스퀴옥산 수지를 1:150~150:1 의 중량비로 함유하는 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 10] 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 조성물은 유중수형, 수중유형, 유분산형으로 이루어진 군에서 선택된 유형인 메이크업 화장품 조성물.
- [청구항 11] 제1항 또는 제2항에 기재된 메이크업 화장료를 사용하여 피부 보습을 증진하는 방법.
- [청구항 12] 제1항 또는 제2항에 기재된 메이크업 화장료를 사용하여 피부 당김을 방지하는 방법.

[Fig. 1]

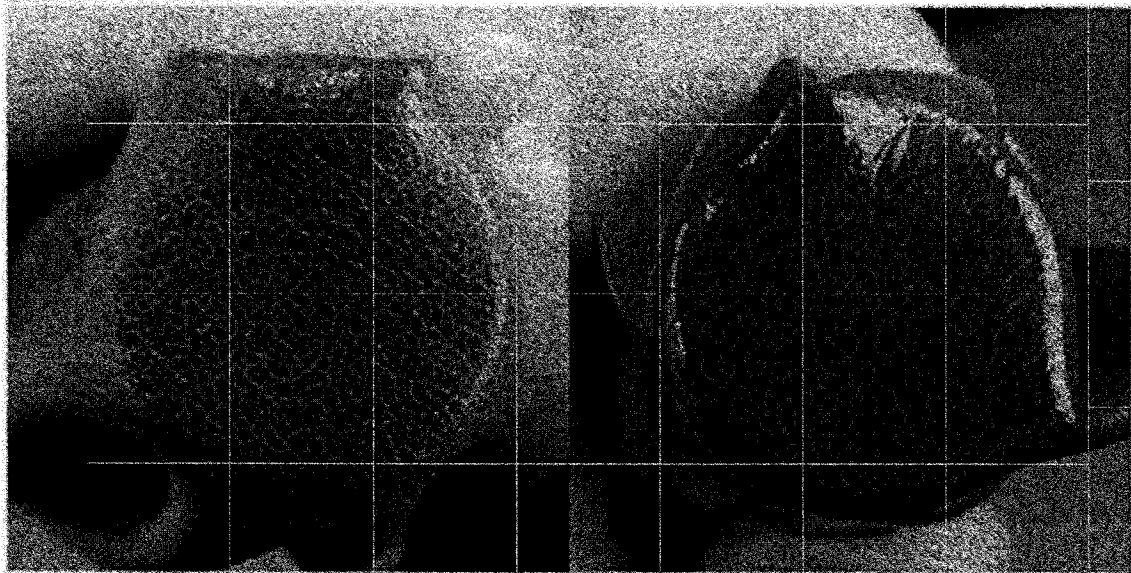
(a)



비교예 4

실시예 2

(b)



비교예 4

실시예 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2013/003412

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K 8/89(2006.01)i, A61K 8/72(2006.01)i, A61Q 1/00(2006.01)i, A61Q 19/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K 8/89; C08J 3/02; A61K 8/891; C08L 83/06; A61K 8/81; A61K 7/06; A61K 7/00; A61K 8/72; A61Q 1/00; A61Q 19/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above
Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as aboveElectronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: propylsilsesquioxane, makeup, moisturizing, siloxane, siloxy silicate

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2007-0004617 A (DOW CORNING CORPORATION) 09 January 2007 See abstract; page 5 line 6-page 11; claims 1-3; and tables 3, 4.	1-12
A	KR 10-2009-0054540 A (AMOREPACIFIC CORPORATION) 01 June 2009 See claims 1-3, 5 and 6.	1-12
A	KR 10-2007-0121059 A (MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.) 26 December 2007 See claims 1-16, 19 and 20.	1-12
A	US 2002-0031488 A1 (KANJI, M. et al.) 14 March 2002 See claims 1-5, 16.	1-12
A	JP 3631941 B2 (WACKER CHEMIE AG) 24 December 2004 See claims 1-5, 10.	1-12

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 JULY 2013 (24.07.2013)

Date of mailing of the international search report

25 JULY 2013 (25.07.2013)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2013/003412

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2007-0004617 A	09/01/2007	CN 1914277 A	14/02/2007
		EP 1711561 A1	18/10/2006
		EP 1711561 B1	20/08/2008
		JP 2007-520619 A	26/07/2007
		JP 4943164 B2	09/03/2012
		US 2007-0166271 A1	19/07/2007
		US 7803358 B2	28/09/2010
		WO 2005-075567 A1	18/08/2005
KR 10-2009-0054540 A	01/06/2009	NONE	
KR 10-2007-0121059 A	26/12/2007	AU 2005-330699 A1	26/10/2006
		CA 2604906 A1	26/10/2006
		CN 101316577 A	03/12/2008
		EP 1874266 A1	09/01/2008
		JP 2008-537952 A	02/10/2008
		US 2005-0249690 A1	10/11/2005
		US 7887785 B2	15/02/2011
		WO 2006-112865 A1	26/10/2006
US 2002-0031488 A1	14/03/2002	JP 2002-097366 A	02/04/2002
		US 2006-0008441 A1	12/01/2006
		US 6991782 B2	31/01/2006
JP 3631941 B2	23/03/2005	BR 0002442 A	02/01/2001
		BR 0002442 B1	13/12/2011
		CA 2307996 A1	22/11/2000
		EP 1057476 A1	06/12/2000
		EP 1057476 B1	26/03/2003
		JP 2000-355521 A	26/12/2000
		TW 500744 A	01/09/2002
		US 6423322 B1	23/07/2002

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))
A61K 8/89(2006.01)i, A61K 8/72(2006.01)i, A61Q 1/00(2006.01)i, A61Q 19/00(2006.01)i

B. 조사된 분야
조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)
A61K 8/89; C08J 3/02; A61K 8/891; C08L 83/06; A61K 8/81; A61K 7/06; A61K 7/00; A61K 8/72; A61Q 1/00; A61Q 19/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌
한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))
eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 프로필실세스퀴옥산, 화장, 보습, 실록산, 실록시실리케이트

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	KR 10-2007-0004617 A (다우 코닝 코포레이션) 2007.01.09 요약; 5쪽 6줄-11쪽; 청구항 1-3; 및 표 3, 4 참조.	1-12
A	KR 10-2009-0054540 A (쥘아모레퍼시픽) 2009.06.01 청구항 1-3, 5, 6 참조.	1-12
A	KR 10-2007-0121059 A (모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈 인크.) 2007.12.26 청구항 1-16, 19, 20 참조.	1-12
A	US 2002-0031488 A1 (KANJI, M. 외 2명) 2002.03.14 청구항 1-5, 16 참조.	1-12
A	JP 3631941 B2 (WACKER CHEMIE AG) 2004.12.24 청구항 1-5, 10 참조.	1-12

추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:
 “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌
 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌
 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌
 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌
 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌
 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌
 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.
 “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.
 “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

국제조사의 실제 완료일 2013년 07월 24일 (24.07.2013)	국제조사보고서 발송일 2013년 07월 25일 (25.07.2013)
--	---

ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (302-701) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-472-7140	심사관 홍성란 전화번호 +82-42-481-5405
---	------------------------------------



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2007-0004617 A	2007/01/09	CN 1914277 A EP 1711561 A1 EP 1711561 B1 JP 2007-520619 A JP 4943164 B2 US 2007-0166271 A1 US 7803358 B2 WO 2005-075567 A1	2007/02/14 2006/10/18 2008/08/20 2007/07/26 2012/03/09 2007/07/19 2010/09/28 2005/08/18
KR 10-2009-0054540 A	2009/06/01	없음	
KR 10-2007-0121059 A	2007/12/26	AU 2005-330699 A1 CA 2604906 A1 CN 101316577 A EP 1874266 A1 JP 2008-537952 A US 2005-0249690 A1 US 7887785 B2 WO 2006-112865 A1	2006/10/26 2006/10/26 2008/12/03 2008/01/09 2008/10/02 2005/11/10 2011/02/15 2006/10/26
US 2002-0031488 A1	2002/03/14	JP 2002-097366 A US 2006-0008441 A1 US 6991782 B2	2002/04/02 2006/01/12 2006/01/31
JP 3631941 B2	2005/03/23	BR 0002442 A BR 0002442 B1 CA 2307996 A1 EP 1057476 A1 EP 1057476 B1 JP 2000-355521 A TW 500744 A US 6423322 B1	2001/01/02 2011/12/13 2000/11/22 2000/12/06 2003/03/26 2000/12/26 2002/09/01 2002/07/23